

УДК 539.293

© 1991

## ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА ХОЛЛА У ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СПЛАВОВ $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ ( $0.1 < x < 0.16$ )

*Л. А. Киракозова, Н. Я. Минина, Г. Нойберт, З. Рогашевски*

В монокристаллических полупроводниковых сплавах  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  ( $0.1 < x < 0.16$ ) при 4.2 К исследованы сопротивление и эффект Холла в условиях сильного ( $\approx 0.3\%$ ) одноосного сжатия вдоль бинарной и биссекторной осей. Вид характерных деформационных зависимостей этих величин определяется сильной анизотропией энергетического спектра сплавов висмут—сурьма, проявляющейся при эффектах перераспределения носителей в  $L$ -долинах под воздействием одноосной деформации, однако качественно различен для однородных и пространственно-неоднородных образцов и может служить критерием их совершенства.

Сплавы  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  представляют собой непрерывный ряд твердых растворов замещения, в которых происходит перестройка от энергетического спектра Bi к спектру Sb. В интервале концентраций  $0.065 \leq x \leq 0.22$  сплав висмут—сурьма является полупроводником. Дно зоны проводимости сплава определяется тремя экстремумами в эквивалентных точках  $L$  зоны Бриллюэна, отделенных от соответствующих экстремумов в валентной зоне прямой энергетической щелью  $E_{gL}$  (рис. 1). Одной из отличительных особенностей этих материалов является относительная простота получения качественных монокристаллов, критерием однородности и совершенства которых до сих пор служила возможность наблюдения в них квантовых осцилляционных эффектов практически во всем интервале концентраций  $x$ . Последнее обстоятельство связано прежде всего с тем, что  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  являются сплавами изовалентных и изоструктурных элементов, основное отличие которых заключается в разнице атомных радиусов. Принято считать, что примесь в  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  мало искажает зонный спектр [1], приводя лишь к небольшому  $\approx 0.1$  мэВ хвосту плотности состояний на границе энергетических зон.

Изменение зонной структуры Bi и сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  ( $0 < x < 0.3$ ) при сильном одноосном сжатии вдоль бинарной  $C_1$  и биссекторной  $C_2$  осей до деформаций  $\varepsilon \approx 0.3\%$  изучено в работах [2–5] с помощью квантовых осцилляций магнитосопротивления. Было показано, что при сжатии имеет место неэквивалентное смещение относительно друг друга  $L_i$ -экстремумов как в валентной зоне, так и в зоне проводимости со скоростью по шкале энергий  $\Delta E/\Delta\varepsilon \approx 10$  эВ/ед. деф., приводящее к перераспределению носителей заряда в этих экстремумах и происходящее таким образом, что величина  $E_{gL}$  остается неизменной [2, 3] (рис. 1). Деформационные потенциалы сплава  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ , определенные в [3], позволяют рассчитать положение уровня Ферми (УФ) относительно зонных экстремумов для любого значения  $\varepsilon$ . Так, сжатие вдоль  $C_2$  приводит при  $\varepsilon = \varepsilon_{k_1}$  к переливу всех электронов в долину  $L_1^c$ , после которого величина  $\Delta S/S_0$ , где  $S$  — сечение соответствующего электронного «эллипсоида» поверхности Ферми (ПФ),

перестаёт изменяться вплоть до возникновения перекрытия зонного термина  $L_1^e$  при  $\epsilon = \epsilon_{k_3}$  с поднимающимися дырочными терминами  $L_{2,3}^h$  [4] (рис. 2). При сжатии вдоль  $C_1$  аналогичный перелив носителей происходит в опускающиеся экстремумы  $L_{2,3}^e$ .

Очевидно, что достаточно сильная одноосная деформация вдоль осей  $C_1$  и  $C_2$  материала с сильно анизотропным законом дисперсии, каковым является сплав висмут—сурьма, должна приводить к сложной деформационной зависимости гальваномагнитных характеристик в результате перераспределения носителей заряда между ставшими неэквивалентными  $L_i$ -долинами. Однако такие кинетические характеристики, как сопротивление и коэффициент Холла, интерпретация которых при исследовании изменений энергетического спектра менее однозначна по сравнению с данными о ПФ,

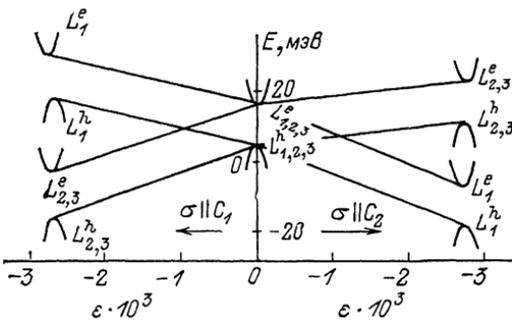


Рис. 1. Зонная структура сплава  $\text{Bi}_{0.9}\text{Sb}_{0.1}$  и ее перестройка при одноосном сжатии усилием  $\sigma \parallel C_1$  или  $\sigma \parallel C_2$ .

Энергия отсчитывается от потолка валентной зоны в точке  $T$  [4].

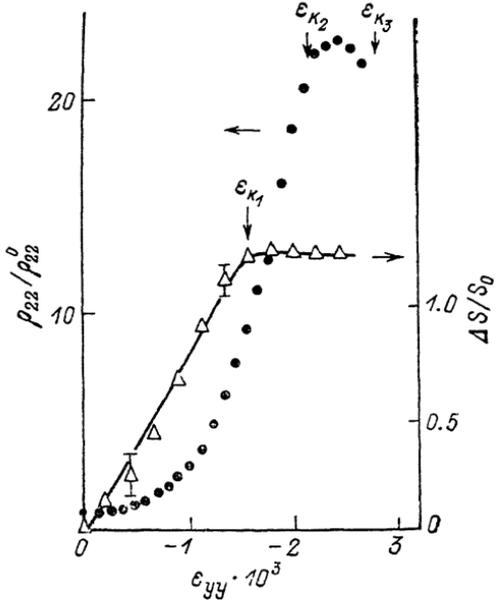


Рис. 2. Зависимость от деформации сжатия относительной величины электросопротивления (левая шкала) и относительной величины минимального сечения ПФ (правая шкала) для образца № 1.

Значения  $\epsilon = \epsilon_{k_1}, \epsilon_{k_2}, \epsilon_{k_3}$  соответствуют полному переливу носителей в экстремум  $L_1^e$ , положению УФ в середине запрещенной зоны, возникновению перекрытия  $L_1^e$  с дырочными экстремумами  $L_{2,3}$ .

в работах [2–5] практически не изучены. Тем не менее отдельные результаты указывают на тот факт, что их изменение при сильном одноосном сжатии не совсем укладывается в общую картину происходящей трансформации ПФ. Так, в работе [4] при деформациях  $\epsilon > \epsilon_{k_1}$ , когда уже осуществлен перелив всех носителей заряда в экстремум  $L_1^e$  и наблюдается стабилизация сечения  $S$  электронной ПФ в  $L_1^e$ , электросопротивление продолжает изменяться (рис. 2). При этом зависимость  $\rho_{22}(\epsilon)/\rho_{22}^0$  имеет вид характерного пика.

Для установления общих закономерностей поведения кинетических характеристик у полупроводниковых сплавов висмут—сурьма при сильном одноосном сжатии вдоль  $C_2$  в настоящей работе были исследованы зависимости электросопротивления и коэффициента Холла до деформаций  $\epsilon \approx -0.3\%$  у нескольких серий образцов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  в интервале концентраций  $0.1 < x < 0.16$ . Измерения проводились как при температуре жидкого гелия, так и при отогреве до  $T \approx 100$  К. Проводился также контроль пространственной однородности распределения сурьмы в сплаве.

### 1. Методика эксперимента

Деформирование образцов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  при низких температурах осуществлялось с помощью калиброванного растягивающего устройства, в кото-

ром растягивающее усилие, приложенное в направлении оси  $X$  к упругому кольцу из немагнитной стали, трансформировалось в одноосное сжатие исследуемого образца, имеющего форму параллелепипеда  $3 \times 0.6 \times 0.6$  мм и жестко закрепленного в этом кольце с помощью полимеризованной смолы «Аральдит» в направлении  $Y$ , перпендикулярном оси  $X$  (данная методика описана в [4]).

Монокристаллические образцы  $Bi_{1-x}Sb_x$  ( $0.1 < x < 0.16$ ) были получены из различных источников. Серия исследуемых образцов вырезалась из массивного блока вдоль оси  $C_1$ , направление которой было определено с точностью  $\approx 1^\circ$  по следам вторичных плоскостей скольжения на базисной плоскости (111). Характеристика образцов приведена в таблице. Все образцы были  $n$ -типа и отличались различным содержанием остаточных примесей; лишь в случае образцов серии № 1 сильное легирование примесью теллура было преднамеренным. Концентрация сурьмы в сплаве,<sup>1</sup> а также величина деформации образца определялись выборочно для характерных образцов серии с помощью рентгеновской дифрактометрии по изменению межплоскостных расстояний в зависимости от величины  $x$  или сжимающей нагрузки  $\sigma$  соответственно.

Характеристики исследованных образцов

Номер серии	Состав	Источник	$\frac{\rho_{1-2}}{\rho_{300}}$	$N_X, \text{ см}^{-3}$	$\mu_X, \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$	$\frac{\rho_{22}^c}{\rho_{22}^0}$	$E_F^0, \text{ мэВ}$
Группа I							
1*	$Bi_{0.9}Sb_{0.1} + 10^{-4} \text{ ат.}\% \text{ Te}$	ИМЕТ	0.59	$2.5 \cdot 10^6$	$1.2 \cdot 10^6$	23	9
2	$Bi_{0.89}Sb_{0.11}$	ЛГПИ	4.7	$3.8 \cdot 10^{15}$	$2.0 \cdot 10^6$	23	3.2
3	$Bi_{0.85}Sb_{0.15}$	БГУ	91	$4.2 \cdot 10^{14}$	$2.5 \cdot 10^5$	3	1
4	$Bi_{0.84}Sb_{0.16}$	БГУ	4.0	$3.3 \cdot 10^{15}$	$2.0 \cdot 10^6$	22	3.0
Группа II							
5	$Bi_{0.37}Sb_{0.13}$	БГУ	3.1	$9.0 \cdot 10^{15}$	$1.2 \cdot 10^6$	21	4.5
6	$Bi_{0.89}Sb_{0.11}$	ЛГПИ	4.3	$4.5 \cdot 10^{15}$	$3.0 \cdot 10^6$	18	3.5

\* Впервые измерены в [3].

Электросопротивление и сигнал Холла измерялись стандартным методом с помощью фотогальванометрического усилителя Ф116/1. В тех случаях, когда было возможно наблюдать квантовые осцилляции магнитосопротивления, параллельно с кинетическими характеристиками исследовалась ПФ с помощью стандартной низкочастотной ( $f \approx 23$  Гц) модуляционной методики. Получение температур выше 4.2 К в приборе с растягивающим устройством подробно описано в [4]. Термостатирование образца в этом случае достигается с помощью перевернутого стакана из пенопласта, укрепленного на длинном тонкостенном стальном штоке, служащем основой растягивающей системы.

Контроль степени однородности распределения сурьмы в образцах проводился с помощью сканирующего электронного микронзондового квантометра SEMQX ARL/USA по изменению интенсивности тормозного рентгеновского излучения электронного пучка на различных участках образца с длиной скана 80 и разрешением 1 мкм.<sup>2</sup>

## 2. Электросопротивление и коэффициент Холла

Электросопротивление и коэффициент Холла исследованы на более чем 40 образцах сплавов  $Bi_{1-x}Sb_x$  из полупроводникового интервала концентраций  $0.1 < x < 0.16$ . Характерные «представители» отдельных серий

<sup>1</sup> Средняя концентрация в области 1 мм<sup>2</sup> между потенциальными контактами.

<sup>2</sup> Измерения проведены в Берлинском государственном университете им. Гумбольдта (БГУ).

образцов, вырезанных, как правило, из одного массивного слитка, приведены в таблице. Сжатие образцов производилось по биссекторной оси  $C_2$ , направление тока  $j$  совпадало с направлением сжатия ( $j \parallel C_2$ ). Коэффициент Холла измерялся в слабых магнитных полях до  $10 \text{ Э}$ .

По характеру изменения электросопротивления с деформацией  $\rho(\epsilon)$  все исследованные образцы (см. таблицу) можно разделить на две группы. Группа I: к ней относятся сплавы, у которых зависимость  $\rho(\epsilon)$  имеет вид характерного пика, относительная высота которого  $\rho(\epsilon)/\rho_0 \approx 20 \div 25$  (рис. 2, 3), однако иногда изменяется всего в 2—3 раза (рис. 4). Деформационная зависимость электросопротивления в форме пика имела место

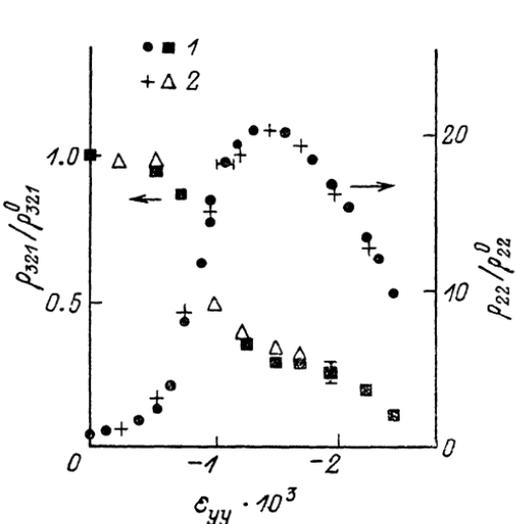


Рис. 3. Деформационная зависимость относительной величины коэффициента Холла (левая шкала) и электросопротивления (правая шкала) для образца № 4.

1 — цикл приложения нагрузки, 2 — цикл снятия нагрузки.

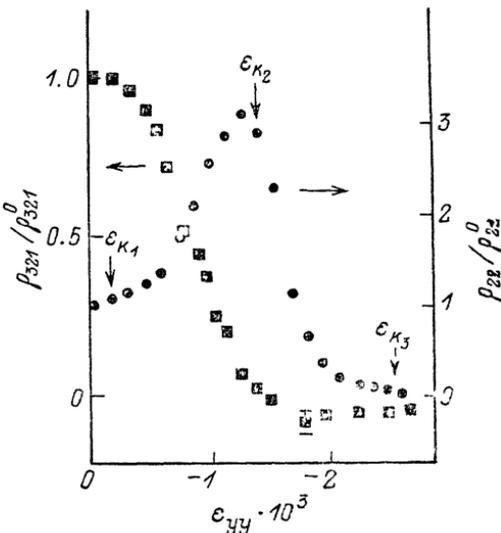


Рис. 4. Зависимость от деформации сжатия относительной величины коэффициента Холла (левая шкала) и относительной величины электросопротивления (правая шкала) для образца № 3.

у подавляющего числа образцов и могла бы считаться характерной, если бы не наблюдение у некоторых монокристаллов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  из исследуемого диапазона концентраций четкого плато на зависимости  $\rho(\epsilon)/\rho_0$  (см. таблицу; группа II, серии № 5, 6). Для образцов (№ 5), на которых было возможно исследовать квантовые осцилляции магнитосопротивления, это плато коррелирует с плато на зависимости сечения ПФ от величины деформации (рис. 5).

Коэффициент Холла соответственно также меняется качественно различным образом: если для образцов с плато на зависимости  $\rho_{22}(\epsilon)$  коэффициент Холла  $\rho_{321}(\epsilon)$  также имеет участок, где он с деформацией не меняется (рис. 5), то для образцов типа № 3 с малым пиком сопротивления горизонтальный участок отсутствует (рис. 4), а у образцов с хорошо развитым максимумом сопротивления имеет место характерный перегиб (рис. 3). Если максимум широкий и напоминает по форме сильно размытое плато, то горизонтальный участок на зависимости  $\rho_{321}(\epsilon)/\rho_{321}^0$  может снова проявиться.

Деформационные зависимости сопротивления при различных температурах приведены на рис. 6. С повышением температуры пик уменьшается, а плато превращается в пик, высота которого с ростом температуры падает. Изменение сопротивления в каждом цикле нагрузки полностью обратимо. Возрастание как начального сопротивления, так и сопротивления на «плато» зависимости  $R(\epsilon)$  в интервале  $4.2 < T < 25 \text{ K}$  не связано с порчей образца, а обусловлено температурной зависимостью; при  $T > 30 \text{ K}$  ( $E_F \approx kT$ ) начальное сопротивление начинает уменьшаться.

Расчет изменения зонной структуры в процессе сжатия для ряда характерных образцов из таблицы, проведенный с использованием деформационных потенциалов из работы [3, 6] (пример такого расчета для образца № 5 дан на рис. 7), позволил установить, что у всех образцов с максимумом сопротивления положение последнего соответствует деформации  $\varepsilon_{k_2}$ , при которой УФ находится приблизительно в середине запрещенного промежутка  $E_{gL_2, 3}$  (в пределах точности  $\Delta E \simeq \pm 3$  мэВ). Для образцов с плато на зависимостях  $\rho_{22}(\varepsilon)/\rho_{22}^0$  (рис. 5) при учете температурного размытия УФ наблюдается соответствие положения концов плато с  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$  по шкале деформаций с критическими значениями деформации  $\varepsilon_{k_1}$  и  $\varepsilon_{k_3}$ , при которых УФ пересекает дно зоны проводимости и потолок валентной зоны в  $L_{2, 3}$  соответственно. При этом энергетический промежуток

$$\Delta E = \sum_{i,j=1}^3 D_{ij}\varepsilon_{ij} = k(\varepsilon_3 - \varepsilon_1) \simeq 18 \text{ мэВ},$$

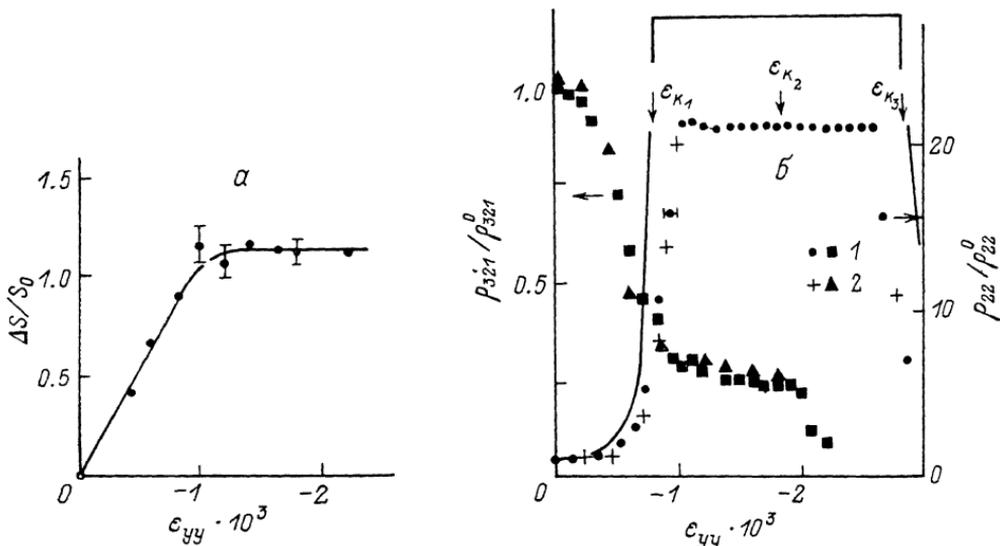


Рис. 5. Зависимость от деформации сжатия относительного измерения величины минимального сечения ПФ у образца № 5 (а). Деформационная зависимость относительной величины коэффициента Холла (левая шкала) и электросопротивления (правая шкала) для образца № 5 (б).

1 — приложение нагрузки, 2 — снятие нагрузки. Сплошная линия — расчетная зависимость  $\rho_{22}(\varepsilon)/\rho_{22}^0$ .

$k = -\mu_1 D_{11} + D_{22} - \mu_3 D_{33} + \eta D_{23}$ ;  $\mu_1, \mu_3$  — коэффициенты Пуассона;  $\eta$  характеризует деформацию сдвига, возникающую в плоскости, перпендикулярной тригональной оси, при сжатии вдоль  $C_2$ ;  $D_{ij}$  — деформационные потенциалы запрещенного промежутка в  $L_{2, 3}$  [3]. В пределах указанной выше точности это значение совпадает с величиной запрещенной зоны  $E_{gL}$ , определенной по эмпирической зависимости от концентрации сурьмы  $x$  из [7]:  $E_{gL} = (10 - 242x)$  мэВ = 21.5 мэВ (для образцов серии № 5  $x = 13$ ).

Причиной сильного обратимого (т. е. не связанного с порчей образца) возрастания сопротивления у исследуемых образцов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  при сжатии вдоль  $C_2$  и токе  $j \parallel C_2$  является сильная анизотропия электронных и дырочных долин в точках  $L$ . Так, по данным работы [8], отношение подвижности вдоль бинарной оси образца  $\mu_1$  к подвижности носителей заряда вдоль биссекторной оси  $\mu_2$  для сплава  $\text{Bi}_{0.87}\text{Sb}_{0.13}$  составляет  $\mu_1/\mu_2 = 119.6$ . В результате перетекания носителей в долину с большей эффективной массой электросопротивление образца увеличивается. Расчет изменения сопротивления при сжатии вдоль  $C_2$  (рис. 5, б, сплошная линия; образец № 5) был проведен на основании выражения для тензора проводимости

полупроводниковых сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  и зависимости концентрации носителей заряда в опускающемся экстремуме  $L_1$  от  $E_F$  в этом экстремуме.

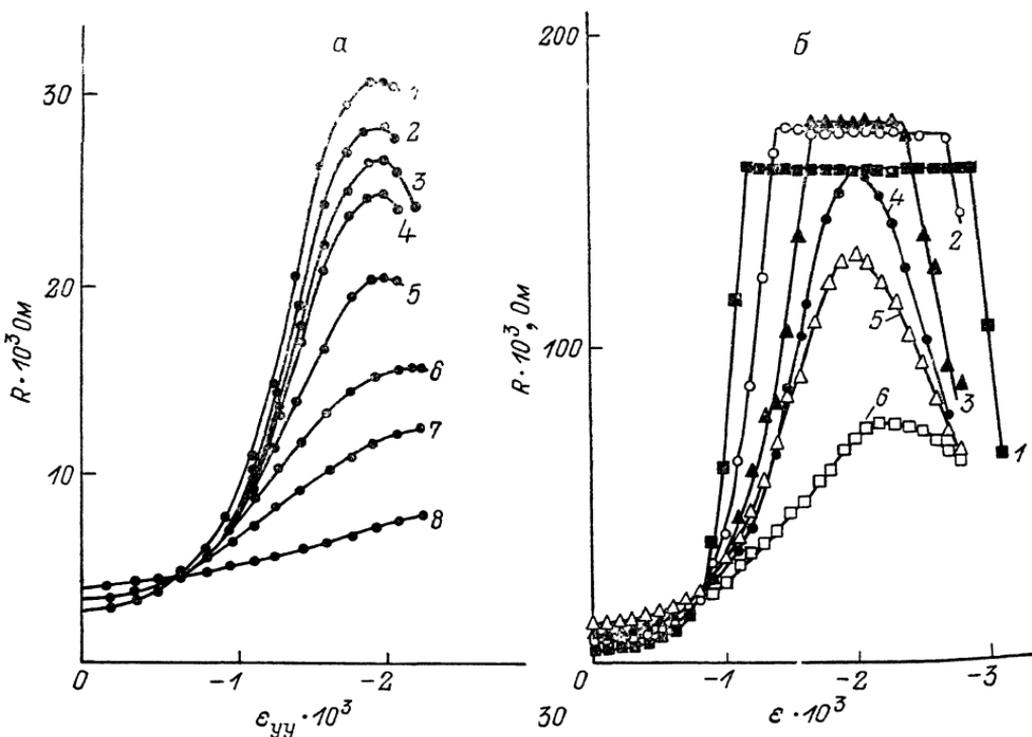


Рис. 6. Деформационная зависимость сопротивления при различных значениях температуры у образца № 1 (а). Зависимость от деформации сжатия относительной величины электросопротивления для образца № 5 при различных температурах (б).  
 а: 1 — 4.2, 2 — 11, 3 — 14 (последний цикл деформирования), 4 — 17.5, 5 — 26, 6 — 32, 7 — 41, 8 — 58 К; б: 1 — 4.2, 2 — 11.9, 3 — 20, 4 — 25.4, 5 — 30.1, 6 — 35.1 К.

Исходное значение энергии Ферми и концентрация носителей тока определялись по величине минимального сечения ПФ с помощью модели энергетического спектра  $\text{Bi}$  и сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  Мак-Клора [9].<sup>3</sup> Расчет изме-

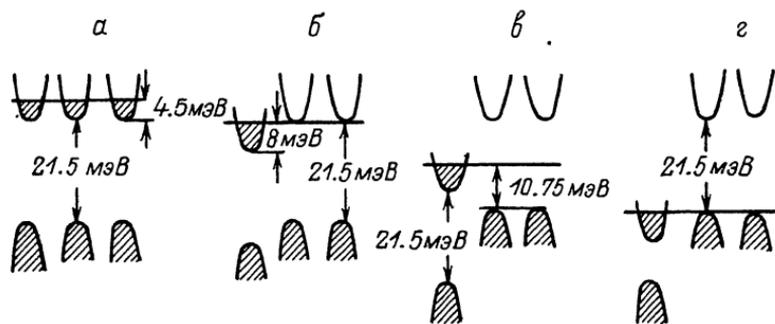


Рис. 7. Смещение электронных и дырочных экстремумов у образца № 5 при сжатии вдоль  $C_2$ .

$$а - \epsilon = 0, б - \epsilon_{k_1} = -0.80 \cdot 10^{-3}, в - \epsilon_{k_2} = 1.85 \cdot 10^{-3}, г - \epsilon_{k_3} = -2.90 \cdot 10^{-3}.$$

нения энергии Ферми с деформацией в различных  $L$ -долинах проводился с использованием тензора деформационного потенциала для этих сплавов [6] и условия сохранения разности концентраций электронов и дырок. При расчетах использовалась анизотропия подвижностей из работы [8],

<sup>3</sup> Параметры спектра Мак-Клора взяты из работы [7].

границы зоны предполагались четко выраженными. При полном переливе всех носителей из более «легких» долин  $L_{2,3}$  в «тяжелую» долину  $L_1$  в результате одноосного сжатия вдоль оси  $C_2$  ( $j \parallel C_2$ ) относительное возрастание сопротивления определяется соотношением

$$\rho_{22}^*/\rho_{22}^0 = \mu_3 (\mu_1 + \mu_2)/2 (\mu_2 \mu_3 - \mu_1^2),$$

что для анизотропии подвижностей из [8] приводит к величине  $\rho_{22}^*/\rho_{22}^0 = 86.7$  (для  $x=0.13$ ) в момент полного перетекания носителей в экстремум  $L_1^e$ . Это в несколько раз превышает экспериментально наблюдаемое возрастание  $\rho_{22}^*/\rho_{22}^0 \approx 20 \div 30$  (рис. 2, 5, таблица) для образцов обеих групп. Такое расхождение можно объяснить тем, что при расчетах не учитывались выключение канала междолинного рассеяния, а также уменьшение эффективности рассеяния на ионизированной примеси из-за роста  $E_F$  в экстремуме  $L_1^e$  при переходе в процессе деформирования от трехдолинного к однодолинному спектру [10], что должно привести к росту подвижности при  $\epsilon > \epsilon_{k_1}$  в 3—4 раза. Видно (рис. 2—5), что для образцов группы II (с плато на зависимости  $\rho_{22}(\epsilon)/\rho_{22}^0$ ) максимальное возрастание сопротивления действительно происходит при деформации  $\approx \epsilon_{k_1}$ , когда УФ проходит через дно зоны проводимости в  $L_{2,3}$ , тогда как у образцов группы I оно затягивается до деформаций  $\epsilon_{k_2}$ , при которых УФ попадает в середину запрещенного промежутка  $E_{gL}$  (рис. 7).

Сравнение с расчетом дает основание считать, что в рамках существующих представлений о зонной структуре сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  и ее изменения при одноосном сжатии экспериментальные кривые  $\rho_{22}(\epsilon)/\rho_{22}^0$ , имеющие четко выраженное плато на участке  $\epsilon_{k_1} < \epsilon < \epsilon_{k_2}$  (при этих деформациях УФ в опускающемся вниз экстремуме  $L_1$  пересекает запрещенный промежуток в  $L_{2,3}$ ; рис. 7), отражают процесс перелива носителей, их анизотропию и полностью коррелируют с происходящими изменениями ПФ (рис. 5). Напротив, деформационные зависимости электросопротивления с максимумом представляются аномальными, несмотря на то что они характерны для большей части исследованных образцов.

Причину такого аномального на первый взгляд поведения следует искать в существенном размытии границ энергетических зон, имеющем место в большей или меньшей степени для всех образцов группы I. К такому выводу приводит характер изменения с температурой вида деформационных зависимостей  $\rho_{22}(\epsilon)/\rho_{22}^0$  (рис. 6, б), который позволяет считать, что трансформация от плато к пику, происходящая на зависимостях в результате температурного размытия энергетической щели, может иметь место и при 4.2 К как следствие достаточно сильной пространственной неоднородности образцов. Под неоднородностью распределения примесей здесь понимаются их микроскопические флуктуации, которые следует отличать от равномерного изменения концентрации вдоль длины кристалла в результате сегрегации примеси в процессе роста. В последнем случае всегда можно выбрать достаточно небольшой участок, где изменение концентрации пренебрежимо мало. Насколько нам известно, исследование микронеподнородности сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  в сканирующем режиме до настоящего времени не проводилось.

### 3. Пространственное распределение висмута и сурьмы в бинарных сплавах $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$

Как упоминалось выше, концентрация Sb в сплавах (см. таблицу) определена на рентгеновском дифрактометре по изменению межплоскостных расстояний в направлении [111]: концентрационная зависимость межплоскостных расстояний в этом направлении установлена в [11]. Этим способом измеряется средняя концентрация сурьмы на облучаемой рентгеновскими лучами площади, которая в настоящей работе  $\approx 1 \text{ мм}^2$ , что соответствует расстоянию между потенциальными контактами.

Используемая в настоящей работе установка SEMQX ARL/USA позволяет осуществить рентгеновский микроанализ в точке  $\sim 1$  мкм<sup>2</sup> и провести непрерывный контроль за соотношением компонент в сплаве на участке 80—100 мкм. Было исследовано по два образца из обеих групп с различным характером деформационной зависимости электросопротивления (образцы № 1, 3 с максимумом и образцы типа № 5 с плато; см. таблицу). Сканирование проводилось на свежих сколах (111) в 8—10 произвольных точках на поверхности каждого образца. На рис. 8 приведены характерные пространственные зависимости интенсивности  $J$  рентгеновского излучения, соответствующего атомам Bi (кривые 1) и атомам Sb (кривые 2) при линейном сканировании образцов типа I (а, б) и II (в).

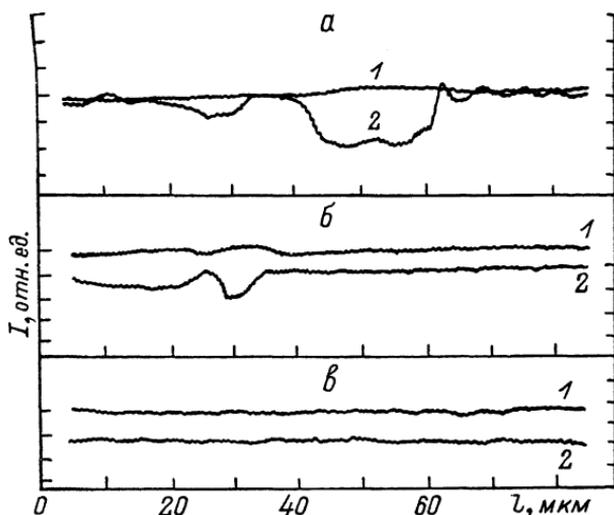


Рис. 8. Характерные пространственные зависимости интенсивности рентгеновского излучения, соответствующего атомам Bi (кривые 1, левая шкала) и атомам Sb (кривые 2, правая шкала) при линейном сканировании образцов типа № 1 (группа I) (а), № 3 (группа I) (б), № 5 (группа II) (в).

Сигналы, соответствующие линиям 1 и 2 на рис. 8, отсчитываются от нулевого фона ( $x=0$ ), а их колебания однозначно указывают на изменение концентрации компонент в сплаве  $Bi_{1-x}Sb_x$ . Величина сигнала 1 на рис. 8, а соответствует в среднем 90 ат. % Bi, тогда как сигнал 2 соответствует  $\approx 10$  ат. % Sb. Поэтому относительно глубоким минимумам (или максимумам) на кривой 2 соответствует относительно небольшое увеличение (или уменьшение) интенсивности на кривой 1. На всех без исключения исследованных участках образцов из группы I наблюдалась заметная микроскопическая неоднородность состава (рис. 8, а, б). Характерный размер областей, в которых меняется соотношение концентрации Bi и Sb, составляет 10—30 мкм, а колебания концентрации в них достигают 1—3 ат. %. На всех исследованных участках образцов из группы II колебаний интенсивности рентгеновского излучения при сканировании поверхности не обнаружено (рис. 8, в).

#### 4. Обсуждение результатов

Имеет место вполне четкая корреляция между характером деформационных зависимостей электросопротивления и коэффициента Холла и степенью однородности распределения примеси Sb у образцов группы I и II. Как упоминалось выше, величина прямой энергетической щели в точках  $L$  описывается эмпирической зависимостью от концентрации сурьмы  $x$ :  $E_{gL} = (10 - 242x)$  мэВ. Флуктуации примеси сурьмы на 1—3 ат. % приводят к изменениям величины  $E_{gL}$  в объеме сплава на 2.5—7.5 мэВ,

которые в кинетических эффектах проявляются как ее размытие на ту же величину. Это связано с тем, что уровень Ферми в объеме сплава одинаков и, следовательно, в областях с меньшей  $E_{gL}$  локальное значение  $E_F$  больше и полное перетекание электронов в экстремум  $L_1$  происходит при больших значениях деформации, а перекрытие с дырочными экстремумами  $L_{2,3}$  — при меньших.

Следует заметить, что для превращения плато в пик на температурных зависимостях  $\rho_{22}(\epsilon)$  достаточно размытия  $2kT \simeq 5$  мэВ (рис. 6, б). Такой эффект вполне объясняется рассмотренными выше флуктуациями концентрации компонент Вi и Sb в сплаве, приводящими к вариации энергетической щели до 7.5 мэВ. Исключением является образец № 3 (соответствующие сканы для этого образца приведены на рис. 8, б), малая величина пиков сопротивления у которого предполагает вариацию  $E_{gL} \simeq E_{gL}/2 \simeq \simeq 10$  мэВ, тогда как флуктуации основных компонент сплава у этого образца сравнительно невелики.

Дополнительным механизмом размытия границ энергетических зон могут служить также флуктуации концентрации заряженных примесей. Обнаружить такие флуктуации с помощью используемой в настоящей работе аппаратуры невозможно вследствие предела ее чувствительности  $\simeq (0.5 \div 1)$  ат.%, однако полностью исключить их вероятность, особенно в неоднородных сплавах, нельзя. Известно [12], что флуктуации заряженных примесей приводят к появлению сильного потенциального рельефа дна (или потолка) зоны и глубоким хвостам плотности состояний, особенно в сильно компенсированных полупроводниках. По-видимому, такая ситуация реализуется в образцах № 3. Они обладают наиболее низкой концентрацией электронов среди всех исследованных образцов при самой низкой их подвижности (см. таблицу), что свидетельствует о присутствии значительного числа акцепторов. Примечательно, что деформационная зависимость коэффициента Холла у этих образцов, изменяющего знак практически сразу за пиком сопротивления, свидетельствует о том, что приток легких дырок из  $L_{2,3}^h$  происходит уже при деформациях  $> \epsilon_{k_2}$  (УФ в середине запрещенной щели). У остальных образцов группы I точка инверсии коэффициента Холла коррелирует со степенью размытия пика (рис. 3, 4, 6).

Уменьшение коэффициента Холла в  $\simeq 3$  раза до точки перегиба, наблюдающееся у образцов обеих групп (кроме образцов серии № 1), трудно объяснить одним лишь изменением Холл-фактора.

Существующее представление о высоком совершенстве и пренебрежимо малом размытии зонных границ у монокристаллических сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  действительно справедливо для отдельных образцов (№ 5, 6; см. таблицу), однако наблюдение квантовых осцилляций магнитосопротивления не может служить единственным критерием такого совершенства. Существование таких осцилляций, так же как и наличие достаточно четких дифракционных максимумов при рентгенографических исследованиях, отражает лишь факт однородности основной части объема образца. Именно по этой причине представление о совершенстве сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  является в целом завышенным.

Существенно более чувствительными к неоднородности образца оказываются транспортные свойства, особенно при одноосных деформациях, позволяющих в процессе одного эксперимента непрерывно провести УФ через дно энергетической зоны и запрещенный промежуток. Вид характерных деформационных зависимостей таких величин, как электросопротивление и коэффициент Холла, определяется сильной анизотропией энергетического спектра сплавов висмут—сурьма, проявляющейся при эффектах перераспределения носителей в  $L$ -долинах под воздействием одноосной деформации, однако, как было показано выше, отражает степень размытия границ энергетических зон и качественно различен для однородных и неоднородных образцов. При этом обнаружена специфическая неоднородность, имеющая место в сплавах  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ , определяющаяся, по-видимому, условиями роста кристалла и заключающаяся в существовании микроско-

пических областей, соотношение компонент в которых отлично от основной части объема.

Вид деформационных зависимостей сопротивления и коэффициента Холла может служить хорошим критерием кристаллического совершенства сплава и четкости границ энергетических зон. Не исключается, что отбор образцов с четко выраженными зонными границами может привести к определенным успехам в их практическом использовании в качестве приемников (а, возможно, и источников) инфракрасного излучения. Используемый нами метод одноосной деформации при исследовании зонной структуры является также перспективным при исследовании примесных состояний и может быть успешно использован при изучении других полупроводников с узкой запрещенной зоной.

В заключение мы пользуемся случаем выразить нашу признательность д-ру А. Крафф и д-ру В. Крааку из Берлинского государственного университета им. Гумбольдта за предоставление высококачественных образцов  $Bi_{1-x}Sb_x$ .

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Брандт Н. Б., Дитманн Х., Пономарев Я. Г. // ФТТ. 1971. Т. 13. № 10. С. 2860—2865.
- [2] Брандт Н. Б., Германн Р., Кульбачинский В. А., Лавренюк М. Ю., Минина Н. Я., Шнайдер Г. // ФТТ. 1982. Т. 24. № 7. С. 1966—1972.
- [3] Богданов Е. В., Лавренюк М. Ю., Минина Н. Я. // ФТП. 1988. Т. 22. № 8. С. 1348—1352.
- [4] Егоров В. С., Лавренюк М. Ю., Минина Н. Я., Савин А. М. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 40. № 1. С. 25—28.
- [5] Брандт Н. Б., Лавренюк М. Ю., Минина Н. Я., Савин А. М. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 6. С. 235—249.
- [6] Лавренюк М. Ю., Минина Н. Я. // ФНТ. 1988. Т. 14. № 1. С. 52—57.
- [7] Брандт Н. Б., Гольшева Г. И., Нгуень Минь Тьху, Судакова М. В., Каширин К. Н., Пономарев Я. Г. // ФНТ. 1987. Т. 13. № 11. С. 1209—1212.
- [8] Редько Н. А., Польшин В. И., Иванов Г. А. // ФТТ. Т. 26. № 1. С. 10—13.
- [9] McClure J. W. // J. Low Temp. Phys. 1976. V. 25. N 5/6. P. 527—540.
- [10] Киракозова Л. А., Минина Н. Я., Савин А. М. // Письма в ЖЭТФ. Т. 52. № 1. С. 693—696.
- [11] Berger H., Christ B., Troschke J. — Cristal res. and Technol. 1982. V. 17. N 10. P. 1233—1239.
- [12] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979. С. 365.

Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова  
Физический факультет

Поступило в Редакцию  
4 марта 1991 г.